05

Повышение прочностных характеристик титана при имплантации ионами аргона

© И.В. Перинская, И.В. Родионов, Л.Е. Куц , О.Д. Тищенко

Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А., Саратов, Россия ¶ E-mail: kuts70@yandex.ru

Поступило в Редакцию 6 сентября 2017 г.

Исследовано влияние имплантации ионов аргона при ускоряющем напряжении $40-130\,\mathrm{kV}$ в диапазоне доз $(1-4)\cdot 10^{16}\,\mathrm{ion/cm^2}$ на морфологию, микротвердость и усталостную прочность титана. Предложен способ упрочнения и модификации поверхности титана ионами аргона $(\mathrm{Ar^+})$, открывающий новые возможности его применения в электротехнических устройствах энергетического, химического и металлургического машиностроения.

DOI: 10.21883/PJTF.2018.10.46104.17030

Проблемы науки и технологии, связанные с методами поверхностной обработки конструкционных материалов, в частности титановых сплавов, подвергающихся воздействию агрессивных сред и применяемых в энергетическом, химическом и металлургическом машиностроении, стимулируют экспериментальные и теоретические исследования физических процессов, моделирование физических явлений при разработке новых технологических методик [1].

Для улучшения механических характеристик конструкционных материалов используется группа технологических методов: вакуумно-конденсационное напыление, микродуговое и термическое оксидирование, цементация, азотирование и другие методы формирования покрытий и функциональных слоев [2–6]. Однако каждый из этих методов недостаточно эффективен для изменения структуры поверхности, придания высокой усталостной прочности и коррозионной стойкости.

Одним из перспективных методов поверхностной обработки материалов, расширяющих возможности влияния на характеристики поверхности и приповерхностного слоя (глубиной до 100 nm), является ионная имплантация. При этом актуальной научной задачей является

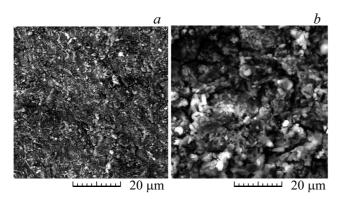


Рис. 1. Электронно-микроскопические изображения поверхности титана, модифицированного ионами аргона $(U_{acc}=75\,\mathrm{kV}).$ $F=1.25\cdot 10^{16}$ (a) и $3.2\cdot 10^{16}$ ion/cm² (b).

экспериментальное исследование и моделирование физических явлений, сопровождающих ионно-лучевую обработку поверхности титана ионами аргона (Ar^+) в углеродсодержащей среде с целью создания на поверхности титана углеродсодержащего покрытия с повышенными механическими характеристиками. Таким образом, цель настоящей работы заключается в исследовании влияния процесса имплантации аргона на механические свойства поверхности титана в зависимости от ускоряющего напряжения и дозы ионов.

Экспериментальные образцы титана марки ВТ1-0 (ГОСТ 19807–91) представляли собой пластины размером 25×20 mm с толщиной 2 mm. Механически обработанная, полированная и химически отчищенная поверхность титановых образцов подвергалась ионно-лучевой обработке ионами аргона в среде углекислого газа при пониженном давлении ($\sim 10^{-3}$ Pa) на установке ионного легирования "Везувий-5" при различных режимах ускоряющего напряжения U_{acc} и дозах имплантации ионов F.

Микротвердость поверхности измерялась методом вдавливания алмазного индентора на твердомере HVS-1000В при нагрузке 20 gf в течение 15 s (ГОСТ 2999–75). Испытания на усталостную прочность проводились по схеме консольного изгиба до разрушения. При этом максимальное изгибающее напряжение по сечению образца находилось

Элемент, соединение	Macca, u	Содержание, rel. un.		
		Исходная поверхность	Модифицированная поверхность	
С	12	500	600	
CH	13	$5 \cdot 10^{4}$	$5 \cdot 10^4$	
CH_2	14	190	230	
$\mathrm{CH_{4}}$	16	180	220	
CO	28	1600	4700	
CO_2	44	250	750	

Таблица 1. Данные ВИМС по количественному содержанию углерода и углеродсодержащих фаз в модифицированном слое титана

в интервале значений 240—450 MPa при частоте цикла нагрузки 22.5 Hz (ГОСТ 25.502–79).

Морфологические изменения фиксировались с помощью растрового электронного микроскопа с холоднополевой эмиссией JSM-6701F (ускоряющее напряжение $0.5-30\,\mathrm{kV}$).

Электронно-микроскопические исследования показали, что при дозах $\sim 1.25 \cdot 10^{16}$ ion/cm² поверхность титана сохраняет вид, характерный для необлученных образцов (рис. 1, a). При дозе $3.2 \cdot 10^{16}$ ion/cm², соответствующей химической пассивации, на его поверхности возникали вытянутые ориентированные образования, система которых схожа с дендритной (рис. 1, b).

Исследование химического состава поверхностных слоев методом вторично-ионной масс-спектрометрии (ВИМС) показывает повышение концентрации углерода на поверхности и в приповерхностном слое титана (табл. 1).

Изменение морфологии и химического состава поверхности титановых образцов после модифицирующей обработки в среде углекислого газа при пониженном давлении в диапазоне экспериментально полученных доз ионов ${\rm Ar}^+(1.25-3.2)\cdot 10^{16}\,{\rm ion/cm^2}$ с ускоряющим напряжением $40-130\,{\rm kV}$ свидетельствует о формировании на ней углеродсодержащей беспористой пленки.

Предлагаемый механизм формирования на титановой поверхности углеродсодержащей беспористой пленки связан с полимеризацией ато-

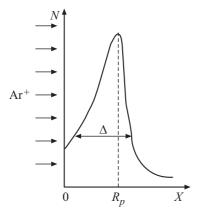


Рис. 2. Профиль распределения имплантируемых ионов Ar^+ в слое металла. R_p — проецируемый пробег ионов.

мов углерода углекислого газа, дозированно вводимого в приемную камеру.

При энергетическом воздействии имплантируемых ионов аргона в углеродсодержащей среде в поверхностном слое адсорбированных фрагментов происходят процессы диссоциации и ионизации молекул. Это приводит к возникновению заряженных радикалов, синтез которых стимулируется энергетическим воздействием внедряемых ионов аргона с характерным профилем распределения и контролируется поступлением электронов из нижележащего металла (рис. 2). По мере увеличения толщины синтезируемого слоя поступление электронов к поверхности затрудняется, и при достижении толщины порядка длины туннелирования электронов рост углеродсодержащей пленки прекращается (рис. 3).

Наиболее интенсивно процесс синтеза протекает на участках слоя с меньшей толщиной и порами, что обеспечивает высокую равномерность беспористой пленки.

Одновременно с формированием углеродсодержащей беспористой пленки повышается структурная равномерность имплантированной ионами аргона поверхности титана. Структура исходных слоев титана в виде разупорядоченных поликристаллов в процессе ионно-лучевой обработки проходит стадии уменьшения размера зерна вплоть до воз-

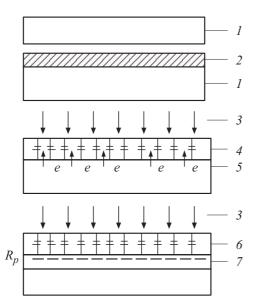


Рис. 3. Схема формирования на поверхности титана углеродсодержащей беспористой пленки в процессе ионно-лучевого модифицирования: I — титан, 2 — углеродные адсорбированные фрагменты, 3 — ионы аргона, 4 — сшивка мономеров (адсорбированных фрагментов), 5 — электроны; 6 — углеродсодержащая беспористая пленка; 7 — область объемных структурных изменений в титане.

никновения аморфной фазы, последующего зарождения поликристаллических включений, увеличения их концентрации. Ионы аргона, образуя с дефектами устойчивые кластеры, стабилизируют метастабильную фазу [7].

Изменение прочностных характеристик модифицированных аргоном образцов титана имеет зависимость от дозы при ионно-лучевой обработ-ке. Установлено, что при дозах ионов аргона менее $1.25 \cdot 10^{16} \, \mathrm{ion/cm^2}$ и более $3.2 \cdot 10^{16} \, \mathrm{ion/cm^2}$ не происходит формирования углеродсодержащей беспористой пленки на поверхности титановой основы образцов, снижаются микротвердость и усталостная прочность имплантированного ионами аргона титана в среде углекислого газа, что подтверждается результатами исследования (табл. 2).

Таблица 2. Зависимость значений микротвердости и усталостной прочности поверхности титана от ускоряющего напряжения и дозы имплантированных ионов аргона

№ п/п	Ускоряющее напряжение ионов Ar ⁺ , kV	Доза ионов Ar ⁺ , 10 ¹⁶ ion/cm ²	Микротвердость H , kgf/mm^2	Усталостная прочность σ_{\max} , MPa
1	_	_	230	350
2	40	0.18	260	350
3	40	1.25	310	400
4	40	2	335	450
5	40	2.5	330	450
6	40	3.2	310	450
7	40	4	250	420
8	130	1.8	260	400
9	130	1.25	325	450
10	130	2	340	450
11	130	2.5	340	450
12	130	3.2	325	450
13	130	4	265	440

Максимальное увеличение микротвердости поверхности титана марки BT1-0 на 25-30% наблюдается при дозе имплантируемых ионов аргона $(1.25-3.2)\cdot 10^{16}\, \mathrm{ion/cm^2},$ что может быть связано с образованием радиационных дефектов. Максимальное повышение усталостной прочности достигается при той же дозе имплантации ионов $\mathrm{Ar^+},$ при которой имеет место максимум зависимости микротвердости от дозы, и практически не зависит от ускоряющего напряжения ионов аргона $\mathrm{Ar^+}$ в исследуемом диапазоне (табл. 2).

Таким образом, установлено, что применение ионной имплантации аргона (Ar+) позволяет повысить микротвердость и усталостную прочность титана. Установлен эффект формирования углеродсодержащей беспористой пленки на поверхности титана при имплантации ионов аргона с ускоряющим напряжением $U_{acc}=40-130\,\mathrm{kV}$ и дозой $F=(1-4)\cdot 10^{16}\,\mathrm{ion/cm^2}$ в среде углекислого газа. Ионная имплантация аргона в среде углекислого газа приводит к увеличению микротвердости поверхности титана BT1-0 на 25–30%, причем максимум достигается в

диапазоне доз ионов $(1.25-3.2)\cdot 10^{16}$ ion/cm². Усталостная прочность образцов титана зависит от дозы имплантированных ионов аргона в среде углекислого газа и имеет наибольшее значение при дозах облучения $(2.0-3.2)\cdot 10^{16}$ ion/cm² с $U_{acc}=40\,\mathrm{kV}$ и $(1.25-3.2)\cdot 10^{16}$ ion/cm² с $U_{acc}=130\,\mathrm{kV}$.

Исследования выполнены при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках государственного задания образовательным организациям высшего образования, подведомственным Минобрнауки РФ (проект 11.1943.2017/4.6).

Список литературы

- [1] Калита В.И., Бочарова М.А., Трушникова А.С., Шатерников Б.Н. // Металлы. 2005. № 3. С. 105–110.
- [2] Нечаев Г.Г., Кошуро В.А. // Физика и химия обраб. материалов. 2015. № 5. С. 29–34.
- [3] Fomin A.A., Dorozhkin S.V., Fomina M.A., Koshuro V.A., Rodionov I.V., Zakharevich A.M., Petrova N., Skaptsov A.A. // Ceram. Int. 2016. V. 42. N 9. P. 10838–10846.
- [4] *Pham V.-H., Lee S.-H., Li Y., Kim H.-E., Shin K.-H., Koh Y.-H.* // Thin Solid Films. 2013. V. 536. P. 269–274.
- [5] Rodionov I.V. // Met. Sci. Heat Treatment. 2014. V. 55. N 11-12. P. 599-602.
- [6] Фомин А.А., Фомина М.А., Родионов И.В., Кошуро В.А., Пошивалова Е.Ю., Щелкунов А.Ю., Скапцов А.А., Захаревич А.М., Аткин В.С. // Письма в ЖТФ. 2015. Т. 41. В. 18. С. 89–95.
- [7] *Перинская И.В., Лясников В.Н.* // Перспективные материалы. 2009. № 5. С. 45–49.